

LITERATUR

- [1] A. Goetzberger, B. Voß, J. Knobloch, *Sonnenenergie: Photovoltaik*, 2. Aufl., Teubner, Stuttgart **1997**.
 - [2] H. Tributsch, *Z.Naturforsch.* **1977**, 32a, 972-985.
 - [3] H. Tributsch, *Ber.Bunsenges.Phys.Chem.* **1977**, 81, 361-369.
 - [4] M. Regula, C. Ballif, M. Remskar, F. Lévy, *J.Vac.Sci.Technol.A* **1997**, 15, 2323-2329.
 - [5] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, *Chemie der Elemente*, VCH, Weinheim **1988**.
 - [6] V. Buck, *Wear* **1987**, 114, 263-274.
 - [7] T. Spalvins, *Thin Solid Films* **1978**, 53, 285-300.
 - [8] T. Spalvins, *J.Vac.Sci.Technol.A* **1987**, 5, 212-219.
 - [9] N. J. Mikkelsen, J. Chevallier, G. Sørensen, C. A. Straede, *Appl.Phys.Lett.* **1988**, 52, 1130.
 - [10] P. D. Fleischauer, *Thin Solid Films* **1987**, 154, 309-322.
 - [11] H. Dimigen, H. Hübsch, P. Willich, K. Reichelt, *Thin Solid Films* **1979**, 64, 221.
 - [12] K. A. B. Andersson, S.-E. Karlsson, N. Ohmae, *Vacuum* **1977**, 27, 379-382.
 - [13] O. Weisser, S. Landa, *Sulphide Catalysts, their Properties and Applications*, Pergamon, Oxford **1973**.
 - [14] G. A. Somorjai, *Introduction to Surface Chemistry and Catalysis*, Wiley, New York **1994**.
 - [15] M. S. Whittingham, in *Intercalated Layered Materials*, (Hrsg.: F. Lévy), Reidel Pub., Dordrecht **1979**, S. 533.
 - [16] J. A. Wilson, A. D. Yoffe, *Adv.Phys.* **1969**, 18, 193-335.
 - [17] W. K. Hsu, B. H. Chang, Y. Q. Zhu, W. Q. Han, H. Terrones, M. Terrones, N. Grobert, A. K. Cheetham, H. W. Kroto, D. R. M. Walton, *J.Am.Chem.Soc.* **2000**, 122, 10155-10158.
 - [18] E. B. Mackie, D. H. Galvan, E. Adem, S. Talapatra, G. Yang, A. D. Migone, *Adv.Mater.* **2000**, 12, 495-498.
 - [19] *Photoelectrochemistry and Photovoltaics of Layered Semiconductors*, (Hrsg.: A. Aruchamy), Kluwer Academic, Dordrecht **1991**.
 - [20] E. Gourmelon, O. Lignier, H. Hadouda, G. Couturier, J. C. Bernède, J. Tedd, J. Pouzet, J. Salardenne, *Sol.Energ.Mat.Sol.C.* **1997**, 46, 115-121.
 - [21] J. C. Bernède, J. Pouzet, E. Gourmelon, H. Hadouda, *Synthetic Metals* **1999**, 99, 45-52.
 - [22] J. C. Bernède, J. Pouzet, E. Gourmelon, H. Hadouda, *Physics of Semiconductor Devices* **1998**, 1, 391-397.
 - [23] J. Ouerfelli, J. C. Bernède, A. Khelil, J. Pouzet, *Appl.Surf.Sci.* **1997**, 120, 1-8.
 - [24] E. Gourmelon, H. Hadouda, J. Bernède, J. Pouzet, *Vacuum* **1997**, 48, 506-514.
 - [25] E. A. Ponomarev, R. Tenne, A. Katty, C. Levy-Clement, *Sol.Energ.Mat.Sol.C.* **1998**, 52, 125-133.
 - [26] H. J. Lewerenz, A. Heller, F. DiSalvo, *J.Am.Chem.Soc.* **1980**, 102, 1877-1880.
-

- [27] L. Engelke, M. Schaefer, M. Schur, W. Bensch, *Chem.Mater.* **2001**, *13*, 1383-1390.
- [28] B. Buras, L. Gerward, *Prog.Crystal Growth and Charact.* **1989**, *18*, 93-138.
- [29] O. Lignier, G. Couturier, J. Salardenne, *Thin Solid Films* **1999**, *338*, 75-80.
- [30] H. Rossner, R. Mientus, K. Ellmer, *HASYLAB Jahresbericht* **1998**, 507.
- [31] K. Ellmer, R. Mientus, H. Rossner, *HASYLAB Jahresbericht* **1999**, 385.
- [32] K. Ellmer, R. Mientus, V. Weiß, H. Rossner, *HASYLAB Jahresbericht* **2000**, 521.
- [33] K. Ellmer, R. Mientus, V. Weiß, H. Rossner, *Nucl.Instr.Meth.Phys.Res.A* **2001**, *467-468*, 1041-1044.
- [34] K. Ellmer, R. Mientus, V. Weiß, H. Rossner, *Meas.Sci.Technol.* **2003**, *14*, 336-345.
- [35] K. Ellmer, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **2000**, *33*, R17-R32.
- [36] S. E. Offermann, N. H. van Dijk, J. Sietsma, S. Grigull, E. M. LAuridsen, L. Margulies, H. F. Poulsen, M. Th. Rekveldt, S. van der Zwaag, *Science* **2002**, *298*, 1003-1005.
- [37] J. Gobrecht, H. Gerischer, H. Tributsch, *Ber.Bunsenges.Phys.Chem.* **1978**, *82*, 1331-1335.
- [38] A. Jäger-Waldau, Dissertation, Universität Konstanz, **1993**.
- [39] A. Jäger-Waldau, M. Ch. Lux-Steiner, E. Bucher, *Solid State Phenomena* **1994**, *37-38*, 479-484.
- [40] A. Jäger-Waldau, M. Ch. Lux-Steiner, E. Bucher, G. Jäger-Waldau, *Conference Record of the 23rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference* **1993**, IEEE, New York, S. 597-602.
- [41] HMI Berlin, **1999**.
- [42] R. G. Dickinson, L. Pauling, *J.Am.Chem.Soc.* **1923**, *45*, 1466-1471.
- [43] J. A. Wollam, R. B. Somoano, *Mater.Sci.Eng.* **1977**, *31*, 289-295.
- [44] J. R. Lince, M. R. Hilton, A. S. Bommannavar, *Thin Solid Films* **1995**, *264*, 120-134.
- [45] L. F. Matheiss, *Phys.Rev.B* **1973**, *8*, 3719-3740.
- [46] W. J. Schutte, J. L. De Boer, F. Jellinek, *J.Solid State Chem.* **1987**, *70*, 207-209.
- [47] D. Tonti, Dissertation, Freie Universität Berlin, **2000**.
- [48] J. C. Wildervanck, F. Jellinek, *Z.Anorg.Allg.Chem.* **1964**, *328*, 309-318.
- [49] A. Ennaoui, K. Diesner, S. Fiechter, J. H. Moser, F. Lévy, *Thin Solid Films* **1997**, *311*, 146-150.
- [50] H. Hadouda, J. Bernède, J. Pouzet, R. Le Ny, *Mater.Sci.Eng.* **1997**, *B45*, 9-16.
- [51] J. H. Moser, F. Lévy, F. Bussy, *J.Vac.Sci.Technol.A* **1994**, *12*, 494-500.
- [52] K. Ellmer, C. Stock, K. Diesner, I. Sieber, *J.Crystal Growth* **1997**, *182*, 389-393.
- [53] J. H. Moser, F. Lévy, *J.Mater.Res.* **1992**, *7*, 734-740.
- [54] S. Tiefenbacher, Dissertation, Technische Universität Berlin, **1998**.
- [55] J. Stabenow, *Z.Kristallogr.* **1959**, *112*, 289-311.
- [56] W. B. Johnson, W. S. Hong, D. W. Readey, *Scripta Metallurgica* **1983**, *17*, 919-922.
- [57] J. R. Lince, T. B. Stewart, M. M. Hills, P. D. Fleischauer, J. A. Yarmoff, A. Taleb-Ibrahimi, *Surf.Sci.* **1989**, *223*, 65-81.
- [58] L. Brewer, R. H. Lamoreaux, in *Binary Alloy Phase Diagrams, Vol. 3*, (Hrsg.: T. B. Massalski), Scott, Jr., **1990**, S. 2660-2661.

- [59] *Binary Alloy Phase Diagrams, Vol. 3*, (Hrsg.: T. B. Massalski), Scott, Jr., **1990**, S. 3295-3296.
- [60] T. Ito, K. Nakajima, *Phil.Mag.B* **1978**, *37*, 773-775.
- [61] H. Dimigen, H. Hübsch, P. Willich, K. Reichelt, *Thin Solid Films* **1985**, *129*, 79-91.
- [62] K. Reichelt, G. Mair, *J.Appl.Phys.* **1978**, *49*, 1245-1247.
- [63] H. Kuwano, K. Nagai, *Proc Int.Ion Engineering Congress, ISIAI '83 & IPAT '83* **1983**, 977-982.
- [64] A. F. Hollemann, E. Wiberg, *Lehrbuch der Anorganischen Chemie*, 91.-100. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin, New York **1985**.
- [65] A. Klein, S. Tiefenbacher, V. Eyert, C. Pettenkofer, W. Jaegermann, *Phys.Rev.B* **2001**, *64*, 205416-1-205416-14.
- [66] T. Böker, Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, **2000**.
- [67] E. Bucher, in *Photoelectrochemistry and Photovoltaics of Layered Semiconductors*, (Hrsg.: A. Aruchamy), Kluwer Acad. Publ., Dordrecht **1991**, S. 1.
- [68] A. Aruchamy, M. K. Agarwal, in *Photoelectrochemistry and Photovoltaics of Layered Semiconductors*, (Hrsg.: A. Aruchamy), Kluwer Acad. Publ., Dordrecht **1991**, S. 319.
- [69] M. K. Agarwal, M. N. Vashi, Y. Patel, *Physics fo Semiconductor Devices* **1998**, *Vol. 1*, 424-427.
- [70] R. Schöllhorn, *Angew.Chem.* **1980**, *92*, 1015-1035.
- [71] M. K. Agarwal, S. Joshi, S. H. Chaki, *Bull.Electrochem.* **1991**, *7*, 416-417.
- [72] M. K. Agarwal, P. D. Patel, S. G. Patel, *Trans.SAEST* **1992**, *27*, 5-7.
- [73] G. Prasad, O. N. Srivastava, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **1988**, *21*, 1028-1030.
- [74] H. Schäfer, *Z.Anorg.Allg.Chem.* **1969**, *369*, 161.
- [75] N. Barreau, J. C. Bernède, J. Pouzet, M. Guilloux-Viry, A. Perrin, *Phys.Stat.Sol.(a)* **2001**, *187*, 427-437.
- [76] N. Barreau, H. El Maliki, E. Gourmelon, S. Marsillac, J. Pouzet, J. C. Bernède, A. Khelil, *16th Eurpean Photovoltaic Solar Energy Conference* **2000**, Glasgow, S. 180-182.
- [77] A. Jäger-Waldau, E. Bucher, *Thin Solid Films* **1991**, *200*, 157-164.
- [78] J. R. Lince, P. D. Fleischauer, *J.Mater.Res.* **1987**, *2*, 827-838.
- [79] V. Buck, *Thin Solid Films* **1991**, *198*, 157-167.
- [80] H. Hadouda, J. Pouzet, Z. K. Alaoui, A. Mallouky, A. Khelil, J. C. Bernède, *Ann.Chim.Fr.* **1994**, *19*, 473-476.
- [81] M. R. Hilton, G. Jayaram, L. D. Marks, *J.Mater.Res.* **1998**, *13*, 1022-1032.
- [82] D.-Y. Wang, C.-L. Chang, W. Y. Ho, *Surf.Coat.Technol.* **1999**, *111*, 123-127.
- [83] J. Pütz, M. A. Aegerter, *Thin Solid Films* **1999**, *351*, 119-124.
- [84] W. Lauwerens, J. Wang, J. Navratil, E. Wieers, J. D'haen, L. M. Stals, J. P. Celis, Y. Bruynseraede, *Surf.Coat.Technol.* **2000**, *131*, 216-221.
- [85] C. Lévy-Clément, R. Tenne, in *Photoelectrochemistry and Photovoltaics of Layered Semiconductors*, (Hrsg.: A. Aruchamy), Kluwer Acad. Publ., Dordrecht **1991**, S. 155.
- [86] W. Kautek, J. Gobrecht, H. Gerischer, *Ber.Bunsenges.Phys.Chem.* **1980**, *84*, 1034.
- [87] G. Chatzitheodorou, S. Fiechter, M. Kunst, J. Luck, H. Tributsch, *Mater.Res.Bull.* **1988**, *23*, 1261-1271.
- [88] W. K. Hofmann, *J.Mater.Sci.* **1988**, *23*, 3981-3986.

- [89] J.-W. Chung, Z. R. Dai, F. S. Ohuchi, *J.Crystal Growth* **1998**, *186*, 137-150.
- [90] A. Matthäus, A. Ennaoui, S. Fiechter, S. Tiefenbacher, T. Kiesewetter, K. Diesner, I. Sieber, W. Jaegermann, T. Tsirlina, R. Tenne, *J.Electrochem.Soc.* **1999**, *144*, 1013-1019.
- [91] G. Salitra, G. Hodes, E. Klein, R. Tenne, *Thin Solid Films* **1994**, *245*, 180-185.
- [92] M. Genut, L. Margulis, G.Hodes, R.Tenne, *Thin Solid Films* **1992**, *217*, 91-97.
- [93] M. Genut, L.Margulis, R.Tenne, G. Hodes, *Thin Solid Films* **1992**, *219*, 30-36.
- [94] P. A. Bertrand, *J.Mater.Res.* **1989**, *4*, 180-184.
- [95] R. Bichsel, F. Lévy, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **1986**, *19*, 1809-1819.
- [96] R. Bichsel, P. Buffat, F. Lévy, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **1986**, *19*, 1575-1585.
- [97] M. Regula, C. Ballif, F. Lévy, *Solid State Phenomena* **1996**, *51-52*, 335-340.
- [98] M. Regula, C. Ballif, J. H. Moser, F. Lévy, *Thin Solid Films* **1996**, *280*, 67-75.
- [99] D. A. Frank-Kamenetskii, *Plasma - The fourth State of Matter*, MacMillan, London **1972**.
- [100] N. Matsunami, Y. Yamamura, Y. Itikawa, N. Itoh, Y. Kazamuta, S. Miyagawa, K. Morita, R. Shimizu, H. Tawara, *Atomic Data and Nuclear Data Tables* **1984**, *31*, 1-80.
- [101] M. P. Seah, *Thin Solid Films* **1981**, *81*, 279-287.
- [102] Y. Yamamura, N. Itoh, in *Ion Beam Assisted Film Growth*, (Hrsg.: T. Itoh), Elsevier, Amsterdam **1989**, S. 59-100.
- [103] J. Hinze, Diplomarbeit, FHTW Berlin / Hahn-Meitner-Institut Berlin, **1999**.
- [104] B. C. Stupp, *Thin Solid Films* **1981**, *84*, 257-266.
- [105] S. Amorosi, M. Anderle, C. Benvenuti, S. Calatroni, J. Carver, P. Chiggiato, H. Neupert, W. Vollenberg, *Vacuum* **2001**, *60*, 89-94.
- [106] K. Ellmer, D. Lichtenberger, *Surf.Coat.Technol.* **1995**, *74-75*, 586-593.
- [107] G. M. Turner, I. S. Falconer, B. W. James, D. R. McKenzie, *J.Appl.Phys.* **1989**, *65*, 3671-3679.
- [108] G. M. Turner, I. S. Falconer, B. W. James, D. R. McKenzie, *J.Vac.Sci.Technol.A* **1992**, *10*, 455-461.
- [109] H. Fujiyama, K. Kuwahara, *Surf.Coat.Technol.* **1995**, *74-75*, 75-79.
- [110] J. Strümpfel, C. May, F. Milde, G. Teschner, *Eight International Conference on Plasma Surface Engineering* **2002**, Garmisch-Partenkirchen.
- [111] A. Aubert, J. P. Nabot, J. Ernoult, P. Renaux, *Surf.Coat.Technol.* **1990**, *41*, 127-134.
- [112] D. Lichtenberger, K. Ellmer, R. Schiek, S. Fiechter, H. Tributsch, *Thin Solid Films* **1994**, *246*, 6-12.
- [113] A. Plagemann, Diplomarbeit, FHTW / Hahn-Meitner-Institut Berlin, **2002**.
- [114] T. Le Mogne, C. Donnet, J. M. Martin, A. Tonck, N. Millard-Pinard, S. Fayeulle, N. Moncoffre, *J.Vac.Sci.Technol.A* **1994**, *12*, 1998-2004.
- [115] A. Lévassieur, E. Schmidt, G. Meunier, D. Gonbeau, L. Benoist, G. Pfister-Gouillouzo, *Journal of Power Sources* **1995**, *54*, 352-355.
- [116] P. Reinig, Dissertation, Universität Marburg, **2002**.
- [117] K. Ellmer, *Solid State Phenomena* **1999**, *67-68*, 261-268.
- [118] J. A. Venables, *Introduction to Surface and Thin film Processes*, University Press, Cambridge **2000**.
- [119] G. Rosenfeld, N. N. Lipkin, W. Wulfhekel, J. Kliewer, K. Morgenstern, B. Poelsema, G. Comsa, *Appl.Phys.A* **1995**, *61*, 455-466.
- [120] C. V. Thompson, *Mat.Res.Soc.Symp.Proc.* **1993**, *280*, 307-318.

- [121] A. Koma, *Thin Solid Films* **1992**, 216, 72-76.
- [122] T. Tsirlina, V. Lyakhovitskaya, S. Fiechter, R. Tenne, *J.Mater.Res.* **2000**, 15, 2636-2646.
- [123] E. Galun, H. Cohen, L. Margulis, A. Vilan, T. Tsirlina, G. Hodes, R. Tenne, W. Jägermann, K. Ellmer, *Appl.Phys.Lett.* **1995**, 67, 3474-3476.
- [124] Z. Zhang, M. G. Lagally, *Science* **1997**, 276, 377-383.
- [125] Paritosh, D. J. Srolovitz, C. C. Battaile, J. E. Butler, *Acta mater.* **1999**, 47, 2269-2281.
- [126] J. M. García-Ruiz, A. Rodríguez-Navarro, *Mat.Res.Soc.Symp.Proc.* **1995**, 355, 107-112.
- [127] M. Birkholz, B. Selle, E. Conrad, K. Lips, W. Fuhs, *J.Appl.Phys.* **2000**, 88, 4376-4379.
- [128] G. Carter, *Vacuum* **2000**, 56, 87-93.
- [129] T. I. Kamins, T. R. Cass, *Thin Solid Films* **1973**, 16, 147.
- [130] R. Bisaro, J. Maraino, N. Proust, K. Zellama, *J.Appl.Phys.* **1986**, 59.
- [131] Ch. Wild, N. Herres, P. Koidl, *J.Appl.Phys.* **1990**, 68, 973-978.
- [132] J. H. Moser, H. Liao, F. Lévy, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **1990**, 23, 624-626.
- [133] A. Rodríguez-Navarro, *Thin Solid Films* **2001**, 389, 288-295.
- [134] M. S. Whittingham, *J.Electrochem.Soc.* **1976**, 123, 315.
- [135] M. S. Whittingham, *Science* **1976**, 192, 1126.
- [136] M. Inoue, H. Negishi, T. Fujii, K. Takase, Y. Hara, M. Sasaki, *J.Phys.Chem.Solids* **1996**, 57, 1109-1112.
- [137] H. I. Starnberg, H. E. Brauer, H. P. Hughes, *J.Phys.: Condens.Matter* **1996**, 8, 1229-1234.
- [138] F. Jellinek, *Arkiv för Kemi* **1963**, 20, 447-480.
- [139] S. Lemaux, A. S. Golub, P. Gressier, G. Ouvrard, *J.Solid State Chem.* **1999**, 147, 336-340.
- [140] M. Kamaratos, C. Papageorgopoulos, *Solid State Commun.* **1987**, 61, 567-569.
- [141] T. Hryniewicz, W. Sienicki, *Mater.Chem.Phys.* **1996**, 44, 211-214.
- [142] R. Schöllhorn, U. Bethel, W. Paulus, *Revue de Chimie Minerale* **1984**, 21, 545-555.
- [143] T. K. Mandal, S. K. Srivastava, *Mater.Chem.Phys.* **1997**, 47, 283-289.
- [144] V. A. Makara, N. G. Babich, N. I. Zaharenko, V. A. Pasechny, O. V. Rudenko, V. F. Surzhko, L. M. Kulikov, A. A. Semenov-Kobzar, M. M. Antonova, A. A. Chekhovskiy, L. G. Askel-Rud, L. P. Romaka, *Int.J.Hydrogen Energy* **1997**, 22, 233-239.
- [145] L. M. Kulikov, A. A. Semenov-Kobzar, M. M. Antonova, A. A. Chekhovskiy, L. G. Akselrud, R. V. Skolozdra, D. Fruchart, J. L. Soubeyroux, *J.Allloys Comp.* **1996**, 244, 11-15.
- [146] C. Ballif, M. Regula, M. Remskar, R. Sanjines, F. Lévy, *Surfac Science* **1996**, 366, L703-L708.
- [147] J. H. Je, D. Y. Noh, H. K. Kim, K. S. Liang, *J.Appl.Phys.* **1997**, 81, 6126-6133.
- [148] N. Schell, W. Matz, J. Böttiger, J. Chevallier, P. Kringhoj, *J.Appl.Phys.* **2002**, 91, 2037-2044.
- [149] M. Becht, F. Wang, J. G. Wen, T. Morishita, *J.Crystal Growth* **1997**, 170, 799-802.

- [150] H.-Y. Lee, K. S. Liang, C.-H. Lee, T.-B. Wu, *J.Mater.Res.* **2000**, *15*, 2606-2611.
- [151] K. Kanehori, Y. Ito, F. Kirino, K. Miyauchi, T. Kudo, *Solid State Ionics* **1986**, *18-19*, 818-822.
- [152] A. J. Perry, J. Shoenes, *Vacuum* **1986**, *36*, 149-155.
- [153] H.-J. Osten, E. Bugiel, J. Klatt, *Appl.Phys.Lett.* **1992**, *61*, 1918-1920.
- [154] M. Bodeg Ard, K. Granath, L. Stolt, *Thin Solid Films* **2000**, *361-362*, 9-16.
- [155] E. Rudigier, Ch. Pietzker, M. Wimbor, I. Luck, J. Klaer, R. Scheer, B. Barcones, T. Jawhari Colin, J. Alvarez-Garcia, A. Perez-Rodriguez, A. Romano-Rodriguez, *Thin Solid Films* **2002**, eingereicht.
- [156] T. Tsirlina, S. Cohen, H. Cohen, L. Sapir, M. Peisach, R. Tenne, A. Matthaeus, S. Tiefenbacher, W. Jaegermann, E. A. Ponomarev, C. Levy-Clement, *Sol.Energy Mater.Sol.Cells* **1996**, *44*, 457-470.
- [157] N. Barreau, J. C. Bernède, *Thin Solid Films* **2002**, *403-404*, 505-509.
- [158] N. Barreau, J. C. Bernède, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **2002**, *35*, 1197-1204.
- [159] E. Gourmelon, J. C. Bernède, J. Pouzet, G. Sørensen, *Phys.Stat.Sol.(a)* **1997**, *161*, R5-R6.
- [160] H. Hadouda, J. C. Bernède, E. Gourmelon, J. Pouzet, *J.Mater.Res.* **1997**, *32*, 4019-4024.
- [161] C. Ballif, M. Regula, P. E. Schmid, M. Remskar, R. Sanjines, F. Lévy, *Appl.Phys.A* **1996**, *62*, 543-546.
- [162] A. Ennaoui, S. Fiechter, K. Ellmer, R. Scheer, K. Diesner, *Thin Solid Films* **1995**, *261*, 124-131.
- [163] M. Regula, C. Ballif, F. Lévy, *J.Crystal Growth* **1998**, *193*, 109-113.
- [164] A. Oberlin, in *Chemistry and Physics of Carbon*, Vol. 22, (Hrsg.: P. A. Thrower), Dekker, New York **1989**, S. 1-143.
- [165] A. S. Schwartz, J. C. Bokros, *Carbon* **1967**, *5*, 325-330.
- [166] J. H. Moser, F. Lévy, *Thin Solid Films* **1994**, *240*, 56-59.
- [167] F. J. Humphreys, in *Encycolopedia of Applied Physics*, (Hrsg.: G. L. Trigg), VCH, **1996**, S. 227-245.
- [168] A. K. Singh, M. Mohan, C. Divakar, *J.Appl.Phys.* **1982**, *53*, 1221-1223.
- [169] F. J. Humphreys, M. Hatherly, in *Recrystallization and Related Annealing Phenomena*, Pergamon, Oxford **1995**, S. 173-220.
- [170] Q. Z. Hong, J. G. Zhu, J. W. Mayer, W. Xia, S. S. Lau, *J.Appl.Phys.* **1992**, *71*, 1768-1773.
- [171] R. J. Kasica, E. J. Cotts, R. G. Ahrens, *Mat.Res.Soc.Symp.Proc.* **1996**, *398*, 301-305.
- [172] M. F. Ng, M. J. Cima, *J.Mater.Res.* **1997**, *12*, 1306-1314.
- [173] M. A. Parker, T. L. Hylton, K. R. Coffey, J. K. Howard, *Mat.Res.Soc.Symp.Proc.* **1993**, *280*, 625-628.
- [174] C. Ziebert, A. Sternberg, H. Schmitt, K.-H. Ehses, J. K. Krüger, *Ferroelectrics* **2001**, *258*, 251-264.
- [175] E. F. Skelton, S. B. Qadri, A. W. Webb, C. W. Lee, J. P. Krikland, *Rev.Sci.Instr.* **1983**, *54*, 403-409.
- [176] R. J. Francis, S. J. Price, S. OBrien, A. M. Fogg, D. OHare, T. Loiseau, G. Férey, *Chem.Commun.* **1997**, 521-522.
- [177] W. H. Bragg, W. L. Bragg, *Proc.Roy.Soc.London (A)* **1913**, *88*, 428.
- [178] M. M. Günter, Dissertation, Technische Universtiät Berlin, **2001**.

- [179] A. R. West, *Grundlagen der Festkörperchemie*, VCH, Weinheim **1992**.
- [180] A. Quad, Dissertation, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, **2001**.
- [181] G. M. Zorn, *Refsim1.1, Analytical Application Note*, Siemens, **1994**.
- [182] L. R. Doolittle, *Nucl.Instr.Meth.Phys.Res.B* **1985**, *9*, 344-351.
- [183] W. Bohne, J. Röhrich, G. Röschert, *Nucl.Instr.Meth.Phys.Res.B* **1998**, *136-138*, 633-637.
- [184] M. Birkholz, W. Bohne, J. Röhrich, A. Jäger-Waldau, M. Ch. Lux-Steiner, *J.Crystal Growth* **1999**, *197*, 571-575.
- [185] CD Römpp Chemie Lexikon, Version 1.0, Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York **1995**.
- [186] A. R. Nyaiesh, L. Holland, *Vacuum* **1981**, *31*, 315-317.
- [187] Th. Jung, A. Westphal, *Mat.Sci.Tech.* **1991**, *A140*, 528-533.
- [188] R. Puxkandl, I. Zizak, O. Paris, J. Keckes, W. Tesch, S. Bernstorff, P. Purslow, P. Fratzl, *Philos.Trans.R.Soc.Lond.B Biol.Sci.* **2002**, *357*, 191-197.
- [189] S. Brennan, P. H. Fuoss, J. L. Kahn, D. W. Kisker, *Nucl.Instr.Meth.Phys.Res.A* **1990**, *291*, 86-92.
- [190] P. H. Fuoss, D. W. Kisker, F. J. Lamelas, G. B. Stephenson, P. Imperatori, S. Brennan, *Phys.Rev.Lett.* **1992**, *69*, 2791-2794.
- [191] J. Q. Zheng, M. C. Shih, X. K. Wang, S. Williams, P. Dutta, R. P. H. Chang, J. B. Ketterson, *J.Vac.Sci.Technol.A* **1991**, *9*, 128-132.
- [192] U. Niggemeier, K. Lischka, W. M. Plotz, V. Holy, *J.Appl.Cryst.* **1997**, *30*, 905-908.
- [193] A. R. Woll, R. L. Headrick, S. Kycia, J. D. Brock, *Phys.Rev.Lett.* **1999**, *83*, 4349-4352.
- [194] W. Matz, N. Schell, W. Neumann, J. Böttiger, J. Chevallier, *Rev.Sci.Instr.* **2001**, *72*, 3344-3348.
- [195] G. B. Stephenson, J. A. Eastman, O. Auciello, A. Munkholm, C. Thompson, P. H. Fuoss, P. Fini, S. P. DenBaars, J. S. Speck, *MRS Bulletin* **1999**, 21-25.
- [196] J. Böttiger, J. Chevallier, J. H. Petersen, N. Schell, W. Matz, A. Mücklich, *J.Appl.Phys.* **2002**, *91*, 5429.
- [197] W. Braun, *Applied RHEED*, Springer, Berlin **1999**.
- [198] A. Pohlers, *Exp.Tech.Phys.* **1988**, *36*, 97-103.
- [199] B. C. Giessen, G. E. Gordon, *Science* **1968**, *159*, 973-975.
- [200] *Forschung mit Synchrotronstrahlung in Deutschland - Status und Perspektiven*, Komitee für Forschung mit Synchrotronstrahlung, **2001**.
- [201] *BESSY, Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m.b.H.*, **1999**.
- [202] M. J. Geselbracht, R. I. Walton, E. S. Cowell, F. Millange, D. OHare, *Rev.Sci.Instr.* **2000**, *71*, 4177-4181.
- [203] J. S. O. Evans, R. J. Francis, D. OHare, S. J. Price, S. M. Clark, J. Flaherty, J. Gordon, A. Nield, C. C. Tang, *Rev.Sci.Instr.* **1995**, *66*, 2442-2445.
- [204] F. Ronci, B. Scrosati, V. R. Albertini, P. Perfetti, *J.Phys.Chem.B* **2001**, *105*, 754-759.
- [205] S. L. Colston, S. D. M. Jacque, P. Barnes, A. C. Jupe, C. Hall, *J.Synchrotron Rad.* **1998**, *5*, 112-117.
- [206] Ch. Pietzker, E. Rudigier, J. Klaer, I. Luck, R. Scheer, *HASYLAB Jahresbericht* **2001**, 541-542.

- [207] K. Ellmer, R. Mientus, H. Rossner, *Surf.Coat.Technol.* **2001**, 142-144, 1094-1099.
- [208] K. Ellmer, R. Mientus, V. Weiß, H. Rossner, *HASYLAB Jahresbericht 2001*, 501.
- [209] J. W. Otto, *Nucl.Instr.Meth.Phys.Res.A* **1997**, 384, 552-227.
- [210] J. Staun Olsen, B. Buras, L. Gerward, S. Steenstrup, *J.Phys.E: Sci.Instrum.* **1981**, 14, 1154-1158.
- [211] J. W. Otto, *HASYLAB Jahresbericht 1993*, 931.
- [212] R. Boehler, N. von Bargaen, A. Chopelas, *J.Geophys.Res.* **1990**, 95, 21731-21736.
- [213] *Handbuch der Halbleiter-Detektoren für Nuklear-Strahlung*, Detector Systems GmbH, Mainz **1 A.D.ohne Jahr**.
- [214] D. Walker, S. M. Clark, R. L. Jones, L. M. Cranswick, *J.Synchrotron Rad.* **2000**, 7, 18-21.
- [215] L. Gerward, S. Morup, H. Topsoe, *J.Appl.Phys.* **1976**, 47, 822.
- [216] M. Klenk, O. Schenker, U. Probst, E. Bucher, *Sol.Energy Mater.Sol.Cells* **1999**, 58, 299-319.
- [217] B. L. Henke, E. M. Gullikson, J. C. Davis, *Atomic Data and Nuclear Data Tables* **1993**, 54, 181-342.
- [218] R. Jenkins, R. W. Gould, D. Gedcke, *Quantitative X-ray Spectroscopy*, 2. Aufl., Dekker, New York **1995**.
- [219] M. Mantler, *Prog.Crystal Growth and Charact.* **1987**, 14, 213-261.
- [220] *International Tables of X-Ray Crystallography*, Birmingham **1986**, S. 157.
- [221] M. O. Krause, *J.Phys.Chem.Ref.Data* **1979**, 8, 307.
- [222] F. Pedraza, J. Cruz-Reyes, D. Acosta, M. J. Yañez, M. Avalos-Borja, S. Fuentes, *J.Phys.: Condens.Matter* **1993**, 5, A219-A220.
- [223] J. Pelleg, L. Z. Zevin, S. Lungo, *Thin Solid Films* **1991**, 197, 117-128.
- [224] R. Koch, *J.Phys.: Condens.Matter* **1994**, 6, 9519.
- [225] J. Hinze, K. Ellmer, *J.Appl.Phys.* **2000**, 88, 2443-2450.
- [226] E. Borsella, S. Botti, M. C. Cesile, S. Martelli, A. Nesterenko, *Materials Science Forum* **1998**, 278-281, 636-641.
- [227] P. Gribi, Z. W. Sun, F. Lévy, *J.Phys.D: Appl.Phys.* **1989**, 22, 1210-1216.
- [228] D. W. Hoffmann, J. A. Thornton, *J.Vac.Sci.Technol.* **1980**, 17, 380.
- [229] M. Zeitler, S. Sienz, H. Neumann, M. Zeuner, J. W. Gerlach, B. Rauschenbach, *Nucl.Instr.Meth.Phys.Res.B* **1998**, 139, 327-331.
- [230] J. W. Gerlach, T. Kraus, S. Sienz, M. Moske, M. Zeitler, B. Rauschenbach, *Surf.Coat.Technol.* **1998**, 103-104, 281-286.
- [231] A. Segmüller, M. Murakami, in *Analytical Techniques for Thin Films*, (Hrsg.: K. N. Rosenberg), Academic Press, Boston **1988**, S. 143-200.
- [232] R. Cebulla, R. Wendt, K. Ellmer, *J.Appl.Phys.* **1998**, 83, 1087-1095.
- [233] Landoldt-Börnstein, III/11, S. 44, **1979**.
- [234] Landoldt-Börnstein, III/29a, **1992**.
- [235] C. Sourisseau, M. Fouassier, M. Alba, A. Ghorayeb, O. Gorochov, *Mater.Sci.Eng.* **1989**, B3, 119-123.
- [236] C. Sourisseau, F. Cruège, M. Fouassier, *Chem.Phys.* **1991**, 150, 281-293.
- [237] A. Matthäus, Diplomarbeit, Universität Bielefeld / Hahn-Meitner-Institut Berlin, **1996**.

- [238] K. Kobs, H. Dimigen, H. Hübsch, H. J. Tolle, R. Leutenecker, H. Ryssel, *Mater.Sci.Eng.* **1987**, *90*, 281-286.
- [239] S. K. Kim, Y. H. Ahn, *Proc.KORUS, 4th Korea-Russia Int.Symp.Science and Technol.* **2000**, *3*, 362-368.
- [240] Xiaodong Zhu, W. Lauwerens, P. Cosemans, M. Van Stappen, J. P. Celis, L. M. Stals, Jiawen He, *Surf.Coat.Technol.* **2002**.
- [241] R. N. Bolster, I. L. Singer, J. C. Wegand, S. Fayeulle, C. R. Gossett, *Surf.Coat.Technol.* **1991**, *46*, 207-216.
- [242] U. Buchenau, in *Dünne Schichten und Schichtsystem - Vorlesungsmanuskripte des 17. IFF-Ferienkurses*, Forschungszentrum Jülich, Jülich **1986**, S. 329-342.
- [243] P. Kuppusami, K. Diesner, I. Sieber, K. Ellmer, *Mat.Res.Soc.Symp.Proc.* **2002**, *721*, 171-176.
- [244] C. V. Thompson, *Annu.Rev.Mater.Sci.* **1990**, *20*, 268.
- [245] M. R. Hilton, P. D. Fleischauer, *J.Mater.Res.* **1990**, 406-421.
- [246] M. K. Agarwal, K. Nagi Reddy, H. B. Patel, *J.Crystal Growth* **1979**, *46*, 139-142.
- [247] Y. Tomm, A. Ramirez, unveröffentlichte Ergebnisse.
- [248] V. Buck, *Thin Solid Films* **1986**, *139*, 157-168.
- [249] A. Mallouky, J. C. Bernède, *Thin Solid Films* **1988**, *158*, 285-298.
- [250] M. Rühle, in *Dünne Schichten und Schichtsystem - Vorlesungsmanuskripte des 17. IFF-Ferienkurses*, Forschungszentrum Jülich, Jülich **1986**, S. 299-316.
- [251] I. Endler, A. Leonhardt, U. König, H. Van den Berg, W. Pitschke, V. Sottke, *Surf.Coat.Technol.* **1999**, *120-121*, 482-488.
- [252] J. S. Speck, J. Steinbeck, M. S. Dresselhaus, *J.Mater.Res.* **1990**, *5*, 980-988.
- [253] J.-W. Chung, Z. R. Dai, K. Adib, F. S. Ohuchi, *Thin Solid Films* **1998**, *335*, 106-111.
- [254] R. Würz, D. Fuertes Marrón, A. Meeder, A. Rumberg, S. M. Babu, Th. Schedel-Niedrig, U. Bloeck, P. Schubert Bischoff, M. Ch. Lux-Steiner, *Thin Solid Films* **2002**.
- [255] F. Lévy, J. H. Moser, *Surf.Coat.Technol.* **1994**, *68/69*, 433-438.
- [256] M.-H. Whangbo, J. Ren, S. N. Magonov, H. Bengel, B. A. Parkinson, A. Suna, *Surf.Sci.* **1995**, *326*, 311-326.
- [257] K. Kopitzki, *Einführung in die Festkörperphysik*, Teubner, Stuttgart **1986**.
- [258] D. Fuertes Marrón, A. Meeder, R. Würz, S. M. Babu, M. Rusu, Th. Schedel-Niedrig, M. Ch. Lux-Steiner, *PV in Europe: From PV Technology to Energy Solutions*, Rom **2002**, eingereicht.
- [259] H. J. Lewerenz, H. Jungblut, *Photovoltaik*, Springer, Berlin, Heidelberg, New York **1995**.
- [260] S. Fiechter, persönliche Mitteilung.
- [261] S. M. Davis, J. Carver, *Appl.Surf.Sci.* **1984**, *20*, 193-198.
- [262] T. Kiesewetter, Y. Tomm, M. Turrion, H. Tributsch, *Sol.Energ.Mat.Sol.C.* **1999**, *59*, 309-323.

